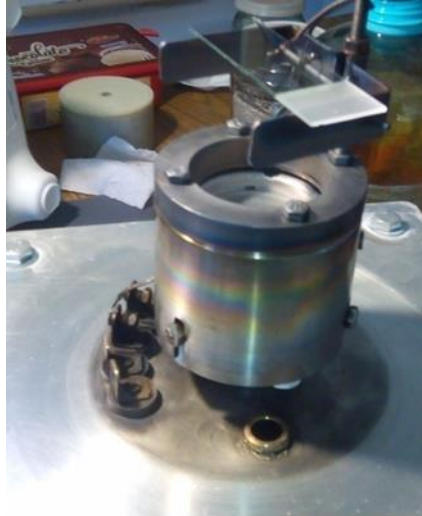


Physical Vapor Deposition by Magnetron Sputtering (PVDMS)

1. Producer: homemade



2. Specificații:

PVDMS folosește procedeul fizic de descarcare în plasma de current continuu pentru a produce vapori de material, care sunt apoi depozitați pe obiectul care necesită acoperire. Se utilizează ca atmosferă de lucru vidul în intervalul 10^{-2} - 10^{-3} mTorr. Vacuumul este asigurat prin utilizarea unei unități de vid compuse dintr-o pompă mecanică. Sputteringul materialelor se face cu ajutorul unei surse circulare plane. Clopotul incintă este fabricat din sticlă și are un volum de opt litri.

3. Domeniu de utilizare

PVD MS se utilizează la fabricarea articolelor care necesită filme subțiri pentru funcții mecanice, optice, chimice sau electronice. În laboratorul nostru putem obține diferite tipuri de filme subțiri, cum ar fi metale (Cu, Zn, Ni, etc) sau aliaje (oțel inoxidabil, aliaje de titan). Alte exemple includ dispozitivele semiconductoare, sub forma unor pelicule subțiri pentru panouri solare.